19日本園特許庁(JP) (1)特許出願公開

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内盔理番号

❸公開 平成2年(1990)1月5日

C 07 D 501/04

8615-4C

1 1 4

8615-4C

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全13頁)

❷発明の名称 ∵

7-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル)-2-ヒドロキシ イミノアセトアミド] -3-セフェム化合物の製造法

> 创特 昭63-330966

多出 願 昭63(1988)12月28日

優先権主張

図1988年1月7日図イギリス(GB) 308800295

個発 明

坂 根

和 夫 兵庫県川西市見野字山形15

@発 明 後藤

二郎

大阪府吹田市五月が丘南7-17-604 大阪府大阪市東区道修町4丁目3番地

の生 願 人 **340** 理人

藤沢薬品工業株式会社 弁理士 青木

1.発明の名称

3~セフェム化合物の製造法

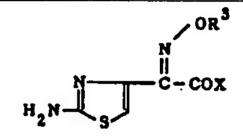
2.特許請求の施理

1) 式:

(武中、R¹ は有機基、

R² はカルポキシ蓋または保護されたカルポキシ 基を意味する)

で示される.7ーアミノー3ーセフェム化合物また はアミノ基におけるその反応性誘導体またはその 塩を、式:



又はハロゲンを意味する)

で示される化合物またはその塩と反応させ、次い で生成する化合物をR³ のアシル基の配離反応に 付すことを特徴とする式:

(大中、R¹ およびR² は前と閉じ意味) で示される7~[2~(2~アミノナアゾール~ 4 - イル) - 2 - ヒドロキシイミノアセトアミ ド】ー3ーセフェム化合物またはその塩の製造 k。

2) 式:

(式中、 R^2 はカルポキシ基または保護されたカルポキシ基、

R³ はアシル蓋を意味する)

で示されるまーセフェム化合物をたはその塩を、R³ のアシル基の脱離反応に付すことを特徴とする式:

(式中、R² は前と同じ意味)
で示される7~[ま~(2 ~ アミノナアゾールー 4 ~ イル) ~ 2 ~ ヒドロキシイミノアセトアミド] ~ 3 ~ セフェム化合物またはその塩の製造地。

3) 式:

 $(式中、R^2 はカルポキシ基または保護されたカルポキシ基、$

R³ はアシル基を意味する) で示される化合物またはその塩。

4) 式:

(式中、R³ はアシル基、 X はハロゲンを意味する)

で示される化合物またはその塩。

5) 2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2-アセトキシイミノアセテルクロリド・塩酸塩 (シン具性体)である特許請求の範囲第4項に記 載の化合物。

6) 欢:

(女中、R³ はアシル基を意味する) で示される化合物またはその塩を、ハロゲン化剤 と反応させることを特徴とする、

(式中、R³ は前と同じ意味であり、 又はハロゲンを意味する) で示される化合物またはその塩の製造法。

3.発明の詳細な説明

・この発明は7-【2-(2-アミノナアゾール - 4 - イル)- 2 - ヒドロキシイミノアセトアミ ド】- 3 - セフェム化合物またはその塩の新規製 造法に関する。

さらに詳しくはこの発明は、下記一般式で示される7-[2-(2-アミノテアソールーもーイル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-8

特別平2-790(3)

ーセフェム化合物またはその塩の、対応する1ー 往来、1-[2-(2-アミノチアゾールー4. 2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2-アシルオキシイミノアセテルハロゲン化物または その塩からの高収率での新規製造法に関する。

(式中、R¹ は有機基、

 R^2 はカルボキシ蓋または保護されたカルボキシ 逝を意味する)。

すなわち、この発明の目的は7- [2- (2-アミノナアゾールーもーイル)ーユーヒドロキシ イミノアセトアミド]ー3ーセフェム化合物(I) またはその塩の新規工業的製造法を提供すること である。

アミノーネーセフェム化合物はたはその出および、 . - イル)- 2-ヒドロキシイミノアセトアミド】... - 3 - セフェム化合物(1)は、例えば下記の方法 により製造されていた。

方法1

- とその反応

方法 2

Y-CH2COCH2COX

(吹中、 R^{1} および R^{2} はそれぞれ前と同じ意味 であり、

R® はエナル基のようなカルボキシ保護基、 R^D はタロロアセナル基のようなアミノ保護基、 R⁴ はヒドロキシ保護基、

又およびYはそれぞれハロゲンを意味する)。

しかしながら、方法1に関しては、二つの余分 な工程、すなわち、アミノ保護基の導入およびア ミノ保護者の設備が必要であり、従って目的セ ブェム化合物の総収率がそれ程高くない。

方法2に関しては、高値なセフェム化合物を初 関工程で使用しなければならず、従って最終化合 物を得るのに非常な高コストとなり、さらにこの 方法ではオキシム部分におけるアンテ異性体も生 成するので、さらに追加してアンチ異性体の分離 工名も必要となる。

この発明の発明者等は7-[2-(2-アミノナアゾールーもーイル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-セフェム化合物の工業的製造のための種々の方法を設定研究し、その結果として2-アミノテアゾールー4-イル)-2-アシルオキシイミノアセテルハロゲン化合物またはその酸付加塩を安定な形で分離し、この発明の新規製造法を完成することに成功した。

この発明の製造技は、式:

$$H_2N \longrightarrow R^1 \qquad (1)$$

(式中、R¹およびR²はそれぞれ前と同じ意味) で示されるフーアミノー3ーセフェム化合物また はアミノ基におけるその反応性誘導体またはその 塩モ、式:

$$H_2N = \frac{N}{S} - COX \qquad (11)$$

(式中、R³ はアシル義であり、又は前と同じ意 味)

で示される2-(2-アミノチアゾールー4-イル)-2-アシルオキシイミノアセチルハロゲン 化物またはその塩と反応させ、次いで生成する化 合物をR³ のアシル基の脱離反応に付して、式:

(式中、R¹およびR²はそれぞれ前と何じ意味) で示される?-[2-(2-アミノチアゾールー 4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミ ド)-3-セフェム化合物を得ることを特徴とする。

取料化合物(I)および目的化合物(I)の舒適な 塩としてはセファロスポリンおよびペニシリンの 分野で使用される常用の塩が挙げられ、無機塩基 との塩、その例として、例えばナトリウム塩、カ リウム塩等のアルカリ金属塩、例えばカルシウム 塩、マグネシウム塩等のアルカリ土類金属塩、ア ンモニウム塩;有機塩基との塩、その例として、 例えばトリエテルアミン塩、ピリジン塩、ピコリ ン塩、エクノールアミン塩、トリエクノールアミ

この発明の製造抜は下記反応式によって示され

またはアミノ基にお けるその反応性誘導 体またはその塩

(式中、 R^1 、 R^2 および R^5 はそれぞれ前と同じ意味)。

原料化合物2-(2-アミノナアゾールー4ーイル)-2-アシルオキシイミノアセテルハロゲン化物(耳)には新規化合物が含まれており、これらは下記反応式で示す方法によって製造すること

ができる。

(式中、 R^3 およびXはそれぞれ前と同じ意味)。

この発明の製造法によって得られる7-【2-(2-アミノナアゾールーもーイル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド】-3-セフェム化合物(1)は強い抗菌作用を発揮して、グラム降性菌 およびグラム族性菌を含む広汎な解原菌の生育を 阻止し、抗菌薬として有用である。

この明細書の上記記載における R^1 、 R^2 および R^3 の定義の好選な例および設明を以下評細に述べる。

この明細書で使用する「低級」とは、特に指示 がなければ、炭素原子1値ないし6個、好ましく は1個ないし4個を有する基を意味するものとす る。

好速な「アシル基」としては、脂肪族アシル基、ならびに芳香族環または複素環を含むアシル基が挙げられる。それらのアシル基の舒適な例としては、例えばホルミル、アセナル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、パレリル、イソバレリル、オキサリル、スクシニル、ピパロイル等の低級アルカノイル基;

例えばメトキシカルポニル、エトキシカルポニ ル、プロポキシカルポニル、1 - シクロプロピル エトキシカルポニル、イソプロポキシカルポニ ル、プトキシカルポニル、第三級プトキシカルポ ニル、ペンナルオキシカルポニル、ヘキシルオキ シカルポニル等の低級アルコキシカルポニル芸;

例えばメシル、エクンスルホニル、プロパンス ルホニル、1ーメナルエクンスルホニル、ブクン スルネニル等の低級アルカンスルホニル盖;

例えばベンゼンスルネニル、トシル等のアレー ンスルネニル基:

何えばベンゾイル、トルオイル、キシロイル、 ナフトイル、フクロイル、インダンカルポニル等 のアロイル基:

例えばフェニルアセナル、フェニルプロピオニ ル等のアル(低級)アルカノイル基:

例えばペンジルオキシカルポニル、フェネテル オキシカルポニル等のアル(低級)アルコキシカ ルポニル基等が挙げられる。

上記アシル部分は塩素、臭素、ファ素および氏素のようなハロゲン等のような適当な最後基少なくとも1個を有していてもよい。

好適な「保護されたカルポキシ基」としては、 ペニシリンまたはセファロスポリン化合物におい てそれらの3位または4位に常用されるエステル 化されたカルボキシ基が挙げられる。

「 エステル化されたカルポキシ盖」の舒道 な 「エステル部分」としては、例えばメチルエステ ん、エテルエステル、プロピルエステル、イソブ ロビルエステル、ブナルエステル、イソプテルエ ステル、第三級プナルエステル、ペンテルエステ ル、第三級ペンテルエステル、ヘキシルエステル 等の低級アルキルエステル、傍えばピニルエステ ん、アリルエステル等の位数アルケニルエステ ル、何えばエナニルエステル、プロピニルエスチ ル等の低級アルキニルエステル、何えばメトキシ メナルエステル、エトキシメナルエステル、イソ プロポキシメナルエステル、1-メトキシエナル ・エステル、1-エトキシエナルエステル等の伝統 アルコキシ(佐装)アルキルエステル、例えばメ ナルテオメテルエステル、エナルテオメテルエス テル、エチルナオエナルエステル、イソプロピル ナオメナルエステル等の伝統アルキルナオ(低 殺)アルキルエステル、併えば2-ヨウドエナル

エステル、2.2.2ートリクロロユチルエステル 等のモノ(またはジまたはトリ)ハロ(低級)ア ルキルエステル、例えばアセトキシメテルエステ ル、プロピオニルオキシメテルエステル、ブチリ ルオキシメナルエステル、イソブナリルオキシメ ナルエステル、バレリルオキシメチルエステル、 ピパロイルオキシメナルエステル、ヘキサノイル オキシメテルエステル、2-アセトキシエテルエ ステル、 2 ープロピオニルオキシエテルエステ ん、1ーアセトキシプロピルエステル等の低級ア ルカノイルオキシ(体験)アルキルエステル、例 えばメナルメシルエステル、2ーメシルエテルエ ステル等の位級アルカンスルホニル(位級)アル キルエステル、例えばペンジルエステル。4~メ トキシベンジルエステル、4~ニトロベンジルエ ステル、フェネナルエステル、ベンズヒドリルエ ステル、トリナルエステル、ピス(メトキシフェ ニル)メナルエステル、3.4ージメドキシベン ジルエステル、4-ヒドロキシー3.6-ジ第三 級ブナルベンジルエステル等の適当な世換基1個

以上を有じていてもよいモノ(またはジまたはト リ)フェニル(低級)アルキルエステルのような 置換基1個以上を有していてもよいアル(低級) アルキルエステル、例えばフェニルエステル、ト リルエステル、第三級プナルフェニルエステル、 キシリルエステル、メシナルエステル、クメニル エステル、サリナルエステル等の適当な置換基1 個以上を有していてもよいアリールエステル、伊 えばフタリジルエステル等の復常環エステル、例 えばトリメナルシリル、トリエナルシリル、イソ プロピルジメテルシリル、第三級プテルジメテル シリル、ジイソプロピルメテルシリル等のトリ (伝統)アルキルシリルのようなトリ世後シリ ル、例えばトリフェニル等のトリアリールシリ ル、例えばトリベンジルシリル等のトリアル(低 扱うアルキルシリル等が挙げられる。

好適な「有機基」としてはセファロスポリン化合物の三位に常用される基が挙げられ、脂肪疾 基、芳母疾基および複素調基、例えばメチル、エ チル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブ ナル、第三級プナル、ペンナル、ネオペンチル、 第三級ペンナル、ヘキシル等の低級アルキル基:

例えばピニル、1ープロペニル、アリル、1ーメナルアリル、1または2または3ープテニル、1または2または3または4ーペンテニル、1または3または4または5ーヘキセニル等の低級アルケニル茶;

例えばフェニル、トリル、キシリル、クメニル、ナフナル等のアリール基:

例えばフリルナオメナル、ナアゾリルチオメナル、ナアジアゾリルナオメナル、テトラゾリルナオメナル
オメナル等の復業環ナオメナル基:

例えば1ーメナルピロリジニオメナル、1ース ナルピロリジニオメナル、1ーメナルー2ーヒド ロキシメナルピロリジニオメナル、1ーメナルー 2ーカルパモイルオキシメナルピロリジニオメナ ル等のような1ー低級アルキルピロリジニオメナ ル等の部四級空常原子を有する複素環メナル差が その何として挙げられる。 好通な「ハロゲン」としては塩素、臭素、沃素 等が挙げられる。

 R^{1} 、 R^{2} および R^{3} の好ましい実施が様は下 足のとおりである。

R¹ は例えばピニル等の位級アルケニル高; または復常環ナオメナル高、好ましくは例えば 1・2・4 - ナアジアゾリル等のイオウ原子1個お よび空常原子1個ないし2個を含む5員労得集復 労選集;

R² はカルポキシ基虫たはエステル化されたカルポキシ基、好ましくはトリ(妊娠)アルキルシリルオキシカルポニル基、好ましくは例えばトリメテルシリルオキシカルポニル等のトリ(C₁ - C₄)アルキルシリルオキシカルポニル第:

 R^3 は低級アルカノイル基、好せしくは例えばアセナル等の $C_1 - C_4$ アルカノイル基である。

この発明の目的化合物(I)の製造法を以下評額に設明する。

製造法1

化合物(胃)またはその塩は、化合物(胃)またはアミノ基におけるその反応性誘導体またはその塩...を、2~(2~アミノナアゾールーもーイル)アシルオキシイミノアセナルハロゲン化物(胃)またはその塩と反応させることにより製造することができる。

化合物(I)のアミノ基における好適な反応性語 準体としては、化合物(I)とピス(トリメナルシ リル)アセトアミド、モノ(トリメナルシリル) アセトアミド等のようなシリル化合物との反応に よって生成するシリル誘導体が挙げられる。

化合物(F)の好道な塩としては、化合物(I)に ついて例示したような塩が挙げられる。

反応は適常、水、アセトン、ジオキサン、アセトニトリル、クロロホルム、塩化メテレン、塩化エテレン、デトラヒドロフラン、酢酸エテル、N・N・ジメテルホルムアミド、ピリジンのような常用の存業中で行われるが、反応に悪影響を及ばさない存業であればその他のいかなる有機存業

中でも反応を行うことができる。これらの常用の 溶媒は水との混合物として使用じてもよい。

反応はアルカリ会馬炭酸水素塩、トリ(低級) アルキルアミン、ピリジン、N-(低級)アルキ ルモルポリン、N・N-ジ(低級)アルキルペン ジルアミン等のような無機塩基または有機塩基を 存在させて行ってもよいし、存在させずに行って もよい。

反応進度は特に限定されないが、通常は冷却下 または常温で反応が行われる。

この反応において、R² のカルポキシ保護基が 反応中またはこの製造技の後処理中に脱離される 場合も、その範囲内に包含される。

この反応に使用される化合物(量)またはその塩 はこの発明の発明者等によって初めて安定な形で 単都され、それによって反応は高収率で進行し、 副生成物の回収工程が不必要となるので非常に使 利になり、反応物の量を最良の条件で容易に管理 することができる。

製造法2

化合物(I)またはその塩は、化合物(I)または その塩をR³ のアシル基の設施反応に付すことに より製造することができる。

この脱離反応は化合物(F)を設定することなく、製造法1と同じ反応提奨中で行うのが好ましい。

この股離反応は加水分解: 遠元等のような常抜に従って行われる。

加水分解としては酸または塩基等を使用する方 波が挙げられる。これらの方法は脱離すべきアシ ル茶の種類によって選択すればよい。

好適な酸としては何えばギ酸、トリフルオロ酢酸、ベンゼンスルホン酸、タートルエンスルホン酸、塩酸等の有機酸または無機酸が挙げられる。 さらに上記酸の代わりに三ファ化ホウ素エチルエーテル等のルイス酸もこの反応に使われる。反応で適した酸は脱離すべきアシル基の種類によって選択することができる。脱離反応を酸によって行う場合には、反応を熔媒の存在下または存在さ

せずに行うことができる。好選な消媒としては例 えばメタノール等のアルコールのような有機消媒 が挙げられる。

好適な塩基としては、例えば水酸化ナトリウ ム、水酸化カリウム等のアルカリ金属水酸化物、 例えば水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム等 のアルカリ土鎖金属水酸化物、例えば炭酸ナトリ ウム、炭酸カリウム等のアルカリ金属炭酸塩、例 えば皮酸マグネシウム、皮酸カルシウム等のアル カリ土頭金属炭酸塩、傍えば炭酸水膏ナトリウ ム、炭酸水素カリウム等のアルカリ金属炭酸水素 塩、洗えば酢酸ナトリウム、酢酸カリウム等のア ルカリ金属酢酸塩、例えば燐酸マグネシウム、燐 厳カルシウム等のアルカリ土類金属清融塩、例え ば燐酸水素ニナトリウム、燐酸水素二カリウム等 のアルカリ金属燐酸水素塩等のような無機塩基が その例として挙げられる。塩蓋を使用する加水分 解はしばしば水または親水性有機溶媒またはそれ らの混合物中で行われる。

選定法としては併えば水素化本ウ書ナトリウム 等の水常化本ウ素アルカリ金属による選定、常用 の触媒を使用する接触還元等がその例として挙げ られる。

反応温度は特に限定されないが、通常は冷却下 ないし加温下に反応が行われる。

この脱離反応においては、R² のカルポキシ保 護差が反応中またはこの製造法の債処理工程中に 脱離する場合もその範囲内に包含される。

この発明の製造法は抗菌性で「13-(2-で ミノナアゾールーもーイル) - 2 - ヒドロキシイ ミノアセトアミド] - 3 - セフェム化合物(I)特 に 3 - ビニルー 3 - セフェム化合物の高収率によ る工業的製造法として非常に有用である。

出発物質の2-('2-アミノナアゾールー4-イル)-2-アシルオキシイミノアセナルハロゲン化物(質)またはその塩の製造抜き以下に説明する。

出発化合物(量)またはその塩は化合物(量e)を ハロゲン化剤と反応させて製造することができ ð.

化合物(量)の好透な塩は塩基との塩であり、化合物(量。)の好透な塩は化合物(1)について例示したような塩基との塩または酸付加塩が挙げられる。

化合物(目 a)は後述の製造法で記された方法: a たは常用の方法によって製造することができる。

この反応で使用される舒適なハロゲン化剤は五 塩化湯、オキシ塩化湯、塩化デオニル、ホスゲン 等のカルボン酸を酸ハロゲン化物に変換できる常 用のものが挙げられる。

反応は通常、塩化メナレン、クロロホルム等のような常用の溶媒中で行われるが、反応に悪影響を及ぼさない溶媒であればその他のいかなる溶媒中でも反応を行うことができる。

反応温度は特に規定されないが、通常は冷却下 または常温で反応が行われる。

化合物(E)の塩酸塩のような酸付加塩は安定な 結晶形で単離されることができ、特に本発明の反 応には好ましい。 以下この発明を製造例および実施例に従って説明する。

製造例 1

ネー(ネーアミノナアゾールー4ーイル)ー2 ーヒドロキシイミノ酢酸エチル(シン異性体) (172g)のエケノール(1.5ℓ)中無潤液に、1 N水酸化ナトリウム水溶液(840±)を提件下48 でで30分間かけて摘下する。摘下許丁後、さらに 阿温で1.5時間提押を続ける。反応混合物を5℃ に冷却し、5℃で1時間提拌後、沈殿を譲取して エケノールで洗浄し、五酸化構で真空乾燥して、 2.ー(2ーアミノナアゾールー4ーイル)ー2ー ヒドロキシイミノ酢酸ナトリウム・二水化物(シン異性体)(156.7g)を得る。

mp: 130-131℃(分解)

IR (APR-4): 3520. 3300. 1600. 1530 cm⁻¹

NHR (DMSO-d₆. 8): 6.97 (2H.br s). 7.33

(1H.s)

この化合物(20g)を水(30mm)から再結晶して純物質(12.6g)を得る。

ap : 133-134℃(分解)

元素分析...C5H4H3O3SHe+2H2Oとして....

計算值: C 24.49. H 3.27. H 17.14.

S 13.08. Ne 9.39. H20 14.69

突游值: C 24.65. B 3.31, x 17.38,

S.13.31. No 9.67, H₂O 14.75

製造例 2

2 - (2 - アミノナアゾールーもーイル) - 2
- ヒドロキシイミノ酢酸ナトリウム・二水化物
(シン具性体)(20.9g)の水(150㎡)溶液
に、無水酢酸(23.5g)を23-25℃で50分間かけ
て加える。紙加中、10%炭酸カリウムを加えて反
応混合をpH6.0-6.3に保つ。攪拌を20分間続けた
は、6 N塩酸を加えて反応混合物を酸性にして
3 とする。生成する沈鷺を増取してエタノールお
よびジイソプロピルエーテルで顕次洗浄し、次い
で互酸化燐で真空乾燥して、水1.1分子を含む 2
- (2 - アミノナアゾールーもーイル) - 2 - ア
セトキシイミノ酢酸(シン異性体)(17.6g)を
得る。

mp : 138-140℃(分解)

IR $(x\beta - A)$: 3400. 3100. 1780. 1630 cm⁻¹

NHR (DMSO-d₆, δ): 2.20 (3H.s). 7.25

(1H.s)

型流例3

五酸化焼(25.0g)の塩化メナレン(250ml) 溶液に、2-(2-アミノナアゾールー4-イ ル)-2-アセトキシイミノ酢酸(シン異性体) (12.5g)を-20℃で撹拌下少量ずつ加える。-10 ~-15℃で75分間撹拌を焼ける。反応混合物にジ イソプロビルエーテル(250ml)を0℃未満の温 度で15分間かけて満下する。生成する沈酸を減取 してジイソプロビルエーテルで洗浄し、次いで五 酸化焼で真空乾燥して、2-(2-アミノナア ゾールー4-イル)-2-アセトキシイミノアセ ナルクロリド・塩酸塩(シン異性体)(13.3g) を得る。

mp : 128-130℃(分解)

IR (x50-A): 3300, 1800, 1780, 1640, 1590 cm⁻¹

製造例 4

2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2-ヒドロキシイミノ酢酸ナトリウム・二水化物(シン異性体)(49.0g)のN・Nージメナルホルムアミド(240ml)溶液に、無水酢酸(40.8g)を撹拌下25℃で30分間かけて摘下する。さらに30分間提拌を続け、次いで酢酸エナル(240ml)を反応混合物に加える。5℃で1時間提拌後、結晶を温取して、2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2-アセトキシイミノ酢酸ナトリウム・N・Nージメナルホルムアミド(シン異性体)(58.84g)を得る。

IR (*5>-*): 3300. 3100. 1765. 1860. 1820. 1550 cm⁻¹

NHR (DHSO-d₈.8) = 2.25 (3H.s), 2.87 (3H.s), 3.02 (3H.s), 7.18 (1H.s), 7.98 (1H.s)

製造例5

2 - (2-アミノナアソールー4-1ル) - 2 - アセトキシイミノ酢酸ナトリウム・N・N - ジ メナルホルムアミド(シン典性体)(58.8g)の水(1050味)溶液に活性炎(5.9g)を提拌下室機で加える。10分間提拌後、混合物を濾過する。 建被を 8 N 塩酸でpH2.5に調整して 5 − 10℃で 3 時間提拌する。沈難を確取して、2 − (2 − アミノナアゾールー4 − イル) − 2 − アセトキシイミノ酢酸・二水化物(シン典性体)(44.5g)を得る。

IR (xfp-A): 3450. 3100. 1750. 1600 cm⁻¹
WHR (DHSO-d₈. 8): 2.17 (3H.m). 7.20
(1N.m)

元常分析 C₇H₇H₃O₄S·2H₂Oとして、 計算値: C 31.70。H 4.15。H 15.85。

S 12.08. H₂O 13.58

東西雄: C 31.88. H 3.82. N 16.08. S 12.28. H₂O 13.39

突旋例1

7ーアミノー3ーピニルー3ーセフェムーもーカルボン酸(4.52g)およびピス(トリメナルシリル)アセトアミド(8世)のテトラヒドロフラ

ン(50ml)潜放に、2-(2-アミノナアゾール
-4-イル)-2-アセトキシイミノアセテルク…
ロリド・塩酸塩(シン異性体)(6.8g)を提拌
下10でで少量ずつ加える。0-5℃で1時間提
拌を続ける。反応混合物を冷水(250ml)中に注
ぎ、次いで生成する沈殿を遺取して冷水で洗浄
し、五酸化増で真空乾燥して、7-[2-(2アミノナアゾールー4ーイル)-2-アセトキシイミノアセトアミド]-3-ビニルー3-セフェムー4ーカルボン酸(シン異性体)(7.44g)(収率:85.1%)を得る。

IR (xy,-x): 3250. 1770. 1750. 1705. 1650. 1590. 1540 cm⁻¹

NHR (DMSO-d_B, 8) : 2.33 (SH. m). 3.60. 3.87 (2H. ABq. J=18Hm). 5.23 (1H. d, J=5Hm). 5.32 (1H. d, J=10Hm). 5.60 (1H. d, J=17Hm). 5.82 (1H. dd, J=8Hm). 5.82 (1H. dd, J=8Hm). 6.92 (1H. dd. J=10Hm). 7.17 (1H. m). 9.97 (1R. d. J=8Hm)

沒篇例 2

7-【2-(2-アミノナアゾールー4-イ ル)ースーアセトキシイミノアセトアミド1-3 ービニルー3ーセフェムー4ーカルポン酸(シン 異性体) (1.3g)および塩化アンモニウム (481.5 mg)の水(21端)とメタノール(15歳)との混合 悔中顯凋液に、10%炭酸カリウム水溶液を接持 下室温で、反応産合物がpRB.Oになるまで地下す る。10%炭酸カリウム水溶液を加えてpH8.0に保 ちながら、周温で1.5時間提择を続ける。1N塩 酸を加えて反応混合物をpH5.0に創盤した後、メ クノールを滅圧下に母去する。 強る水溶液を1 N 塩酸でpH2.5に調整し、次いで5~10℃で30分間 **搅拌する。生成する沈殿を進取して冷水で洗浄** し、次いで五酸化燐で真空乾燥して、7~[2~ (2ーアミンナアゾールーもーイル) - 2 - ヒド ロキシイミノアセトアミド] - 3 - ピニルー3 -セフェムー4ーカルポン酸(シン異性体)(850 ma) (収率: 70.0%) を得る。

IR (x5.-A): 3300, 1780, 1660, 1605.

1540 cm⁻¹

NHR (DMSO-d₈, 8): 3.53. 3.80 (2M, ABq, J=18Hz). 5.17 (1M.d.J=5Hz). 5.28 (1H.d.J=10Hz). 5.57 (1M.d.J=17Hz). 5.75 (1M.dd.J=8Hz.J=5Hz), 6.65 (1H.s). 6.90 (1H.dd.J=17Hz, J=10Hz), 7.07 (2H.br.s). 9.42 (1H.d.J=8Hz). 11.25 (1H.br.s)

実施供3

アーアミノー3ー(1・2・4ーナアジアゾールー5ーイル) テオメチルー3ーセフェムー4ーカルボン酸(990mg) およびモノトリメチルシリルアセトアミド(3.0g) のテトラヒドロフラン(15 mt)溶液に、2ー(2ーアミノナアゾールー4ーイル)ー2ーアセトキシイミノアセチルクロリド・塩酸塩(シン異性体)(937.2mg)を提件下5℃で少量ずつ加える。0ー5℃で1時間提件を続ける。反応混合物を酢酸エチル(30mt)と冷水(30mt)との混合物中に注ぐ。有機層を分取して塩化ナトリウム飽和水溶液で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥して溶媒を減圧下に容安する。残造

をジイソプロピルエーテルで粉砕して、1-[2 -(2-アミノナアソールーもーイル)-2-ア セトキシイミノアセトアミド]-3-(1.2.4 -ナアジアゾールー5-イル)ナオメナルー3-セフェムー4-カルボン酸(シン異性体)(1.45 E)(収率:89.3%)を得る。

IR (x5.-4): 3300. 1770. 1660. 1610.
1530 cm⁻¹

HMR (DMSO-d₆. 5): 3.57. 3.77 (2H.ABq.

J=18Hz), 4.30. 4.60 (2H.ABq.J=14Hz),

5.17 (1H.d.J=5Hz), 5.82 (1H.dd.J=8Hz.

J=5Hz), 7.04 (1H.s), 7.30 (2H.br.s),

8.70 (1H.s), 9.90 (1H.d.J=8Hz)

実施例4

7-[2-(3-アミノナアゾールー4-イル)-2-アセトキシイミノアセトアミド]-3-(1.2.4-ナアジアゾールー5-イル)ナオメナル-3-セフェムー4-カルボン酸(シン異性体)(1.08g)および塩化アンモニウム(321mg)の水(15mg)とメタノール(10mg)との混合

物中懸渦液に、10%以酸カリウム水溶液を搅拌下室温で、反応混合物がpH8.0になる。まで換下する。10%以酸カリウム水溶液を加えてpH8.0に保ちながら、河温で1.5時間撹拌を続ける。1 N塩酸を加えて反応混合物をpH6.0に調整した後、混合物からメケノールを留安する。残る水溶液を1 N塩酸を加えてpH2.5に調整し、5-10℃で30分間浸拌する。生成する沈暖を減取して冷水で洗浄し、次いで五酸化場で実空乾燥して、7-[2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-(1.2.4-ナジアゾールー5-イル)ナオメナルー3-セフェムー4-カルボン酸(シン異性体)(805mg)(収率:80.6%)を得る。

IR (xgo-4): 3200. 3080. 1760. 1690. 1650. 1605. 1550 cm⁻¹

WHR (DHSO-d₆, \$) : 3.73. 3.57 (2H.ABq.
J=18Hz). 4.30. 4.60 (2H.ABq.J=14Hz).
5.15 (1H.d.J=5Hz). 5.78 (1H.dd.J=8Hz.
J=5Hz). 6.65 (1H.s), 7.07 (1H.br.s).

8.70 (1H.s). 9.40 (1M.d, J=5Hz), 11.25 (1M.s)

実施例5

7~[2~(2-アミノナアゾールームーィ ル) - 2 - アセトキシイミノアセトアミド] - 3 - ピニルー3ーセフェムー4ーカルポン酸(シン 異性体)(1.0g)のメタノール(20ml)中語機 液に濃塩酸(0.9mm)を加える。混合物を変温で 1.5時間提拌する。反応溶液に水(20㎡)を加え る。水溶液を炭酸水素ナトリウム飽和水溶液で pH3.0に調整し、維通して少量の不溶物を除去 し、減圧下にメクノールを督法する。残後に塩化 ナトリウム館和水存被(30単)を加え、次いで宝 進で30分間提拌する。生成する結晶を減取し、水 洗して、7-[2-(2~アミノナアゾールーム ーイル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド] ー3ーピニルー3ーセフェムー4ーカルボン酸 (シン具性体)(892mg)(収率:78.5%)を得 ð.

IR (x50-1): 3300. 1780. 1860. 1805.

1540 cm⁻¹

NHR (DHSO-d₆, 5): 3.53. 3.80 (2H.ABq.

J=18Hz). 5.17 (1H.d.J=5Hz). 5.28 (1H.

d.J=10Hz). 5.57 (1H.d.J=17Hz). 5.75

(1H.dd.J=8Hz. J=5Hz). 6.65 (1H.s). 6.90

(1H.dd.J=17Hz. J=10Hz). 7.07 (2H.br.s).

9.42 (1H.d.J=8Hz). 11.25 (1H.br.s)

東海河 6

7-アミノー3-ビニルー3-セフェムー4ーカルボン酸ペンズヒドリル・塩酸塩(2.14g)およびピス(トリメナルシリル)原常(2.04g)のテトラモドロフラン(25mg)溶液に、2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2-アセトキシイミノアセナルクロリド・塩酸塩(シン興性体)(1.7g)を撹拌下0-5℃で加える。0-5℃で30分間撹拌を抜ける。反応混合物に酢酸エナル(50mg)および水(25mg)を加える。生成する沈燥を減取して、7-[2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2-アセトキシイミノアセトアミド]-3-ビニルー3-セフェムー4ーカルボ

ン酸ベンズヒドリル・塩酸塩・酢酸エナル(シン 異性体)(3.25.4.)(収率: 89.6%)を得る。..... IR (x50~4): 1780, 1760, 1705, 1890, 1880. 1630, 1580, 1530 cm⁻¹

NHR (DHSO-d₆, 8): 2.20 (3H, 9), 3.67, 3.87 (2H.ABq.J=18Hz), 5.27 (1H.d.J=5Hz), 5.30 (1H.d.J=10Hz), 5.65 (1H.d.J=17Hz), 5.88 (1H.d.J=8Hz, J=5Hz), 6.75 (1H.dd, J=17Hz, J=10Hz), 6.92 (1H.s), 7.17 (1H. 9), 7.33 (10H.s), 8.97 (1H.d.J=8Hz)

実施例?"

7ーアミノー3ーピニルー3ーセフェルー4ーカルボン酸ペンズヒドリル・塩酸塩(純度:94.5%)(2.27g)および酢酸エテル(85m)のテトラヒドロフラン(25m)中懸潤液に炭酸水常ナトリウム(1.68g)合有水(25m)を撹拌下5℃で加える。混合物を5℃で5分間撹拌する。この混合物に2ー(2ーアミノテアゾールー4ーイル)ー2ーアセトキシイミノアセチルクロリド・塩酸塩(シン異性体)(2.13g)を撹拌下10分間かけ

て橋下して加える。残渣に炭酸水素ナトリウム館和水溶液(2.mm)を加えた後、5.℃で15分間搅拌がある。
た 窓 の で 1.5分間撹拌しながら加える。
生 成 す る 沈 段 を 途 取 し で 計 5 分間撹拌しながら加える。
生 成 す る 沈 段 を 途 取 し で 計 酸 エテルで洗浄して、
フー [2-(2-アミノテアゾールー4-イル)ー2-アセトキシイミノアセトアミド]ー3-ビニルー3-セフェムー4ーカルボン酸ペンズヒドリル・塩酸塩・酢酸エテル(シン異性体)(3:58 g)(収率:98.4%)を得る。

1R (#5--A) 1 1780. 1780. 1705. 1690. 1680. 1630. 1580. 1530 cm⁻¹

变篇偶8

7-[2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2-アセトキシイミノアセトアミド]-3-ビニルー3-セフェムー4-カルポン酸ペンズヒドリル・塩酸塩・酢酸エナル(シン異性体)(300mg)のメケノール(3 mg)感荷液に三ファ化ホケポエナルエーテル(350mg)を室風で加える。混合物を何鑑で1時間撹拌する。混合物にイ

ソプロピルエーテルを加え、沈殿物を譲取し、イソプロピルエーテルで洗浄し、乾燥して、ケー
[2-(2-アミノナアゾールー4-イル)-2
ーヒドロキシイミノアセトアミド]-3-ピニル
-3-セフェムー4-カルボン酸ペンズヒドリル
・塩酸塩(シン異性体)(220mg)(収率:89.4
%)を得る。

HHR (DMSO-d₆. 5) = 3.61. 3.92 (2H.ABq.

J=13Hz). 5.28 (1H.d.J=5Hz). 5.29 (1H.d.

J=10Hz). 5.64 (1H.d.J=17Hz). 5.87 (1H.

dd.J=5Hz. 8Hz). 6.75 (1H.dd.J=10Hz.

17Hz). 6.87 (1H.s). 6.93 (1H.s). 7.35

(13H.s). 9.70 (1H.d.J=8Hz). 12.30

(1H.fp-F)

下記化合物は上記化合物から常法により製造される。

7 - [2 - (2 - アミノナアゾールー4 - イル) - 2 - ヒドロキシイミノアセトアミド] - 3 - ビニルー3 - セフェムー4 - カルボン酸(シン男性体)。

支援纽9

7ープミノー3ーピニルー3ーセフェムー4ー カルポン酸ペンズヒドリル・塩酸塩(2.27g) の塩化メテレン(12.5mm)およびギ酸(230mg) 混合物中溶液に三ファ化ホウ素エテルエーテル (1.42m)モ20℃で浸拌しながら加える。20~30 でで1時間撹拌後、反応混合物にテトラヒドロフ ラン(12.5㎡)を満下して加え、さらにピス(ト リメナルシリル)ウレア(3.58g)を10分間攪拌 しながら加える。混合物に2-(2-アミノナア ソールーもーイル)-2-アセトキシイミノアセ ナルクロリド・塩酸塩(シン異性体)(1.56g) も5℃で1時間攪拌しながら加える。反応混合物 に塩化ナトリウム館和水溶液(25ml)を加えた 後、5℃で10分間接持する。生成する沈殿を譲取 して塩化ナトリウム飽和水溶液で洗浄し、乾燥し て、7-[2-(2-アミノナアゾールー4ーィ ん)-2-アセトキシイミノアセトアミド]-3 ーピニルー3ーセフェムー4ーカルボン酸・塩酸 塩(シン美性体)(3.53g)(収率:91.9%)を

得る。

NMR (DMSO-d₈, 6): 2.22 (3H.s), 3.59, 3.90 (2H.ABq.J=15Hz), 5.24 (1H.d.J=5Hz), 5.32 (1H.d.J=11Hz), 5.59 (1H.d.J=17Hz), 5.80 (1H.dd.J=5Hz, 8Hz), 6.92 (1H.dd. J=11Hz, 17Hz), 7.14 (1H.s), 9.94 (1H.d.J=8Hz)

実施例10

7~[2~(2~アミノナアゾールー4~イル)~2~アセトキシイミノアセトアミド]~3~ピニル~3~セフェム~4~カルボン酸・塩酸塩(シン具性体)(5.30g)のメタノール(10 社)中間測液に濃硫酸(980mg)およびメタノール(5 社)混合物を満下して加える。混合物を23~24℃で30分間提拌した後、5℃にまで冷却する。反応混合物を冷炭酸水煮ナトリウム(2.52g)の水(50社)および酢酸エテル(30社)混合物中に住ぐ。水溶液を炭酸水素ナトリウム飽和水溶液(3.5社)でpB5.0に調整し、減過して少量の不溶物を除去し、減圧下にメタノールおよび酢酸エテ

ルを貸去する。生成する沈殿物を建取し、冷水で洗浄して、7- [2-(2-アミノチアゾールー4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-ピニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)(3.40g)(収率:93.1%)を得る。

IR (xy=-x): 3300, 1780, 1680, 1605, 1540 cm⁻¹

特許出職人 嘉訳漢品工業株式会社 代 理 人 弁理士 青 木 高 彩色

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked	• .
BLACK BORDERS	٠.
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	· ·
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.